Record Display Form

First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection

Print

L6: Entry 10 of 11

File: JPAB

Dec 12, 1986

PUB-NO: JP361282311A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61282311 A

TITLE: DEPILATORY

PUBN-DATE: December 12, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YAMAMOTO, KATSUHIRO SASAKI, TOSHIMITSU SHIDA, MASAYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NITTO ELECTRIC IND CO LTD

APPL-NO: JP60124648
APPL-DATE: June 7, 1985

INT-CL (IPC): A61K 7/155

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a <u>depilatory</u> applicable without necessitating troublesome post-treatment nor causing ill odor and severe pain, and composed of a system consisting of a dissolved <u>polymer</u>, etc., and a system containing a component forming a peelable solid coating film, wherein at least one of the above systems contains a depilatory agent.

CONSTITUTION: The objective <u>depilatory</u> is composed of (A) a system consisting of a dissolved <u>polymer</u> or a dissolved <u>polymer</u>-forming compound (a polymeric compound such as polyacrylic acid or its salt) and (B) a system containing a component which forms a peelable slid coating film by reacting with said <u>polymer</u> or <u>polymer</u>-forming compound, wherein at least one of the systems A and B contains a <u>depilatory</u> agent (e.g. thioglycolic acid). The system B is preferably a metallic salt crosslinking said polymeric compound, a compound causing an acid-base reaction with said polymeric compound, or a compound reactive with a polymeric compound having active group, etc.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO& Japio

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

⑩日本国特許庁(JP)

m 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-282311

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和61年(1986)12月12日

A 61 K 7/155

7417-4C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 脱毛剤

②特 願 昭60-124648

②出 願 昭60(1985)6月7日

 ⑩発 明 者
 山 本
 克 弘

 ⑩発 明 者
 佐 々 木
 利 光

 ⑩発 明 者
 志 田
 正 行

 ⑪出 願 人
 日東電気工業株式会社

茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電気工業株式会社内 茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電気工業株式会社内 茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電気工業株式会社内

茨木市下穂積1丁目1番2号

197代 理 人 井理士 高 島 -

#### 明相

#### 1. 発明の名称

### 脱毛剂

### 2. 特許請求の範囲

(1) ポリマー溶解物またはポリマー形成性化合物溶解物よりなる系 (A系) ならびに該ポリマーまたはポリマー形成性化合物と反応して剝離可能な固化被膜を生じる成分を含有する系 (B系) の二成分系よりなり、A系およびB系の少なくとも一方の系に脱毛薬物を含有させてなる脱毛剤。

(2) B系中に含有される金鳳塩が該ポリマーに 対して架橋を生じることにより、固化被膜を形成 する特許請求の範囲第(1)項記載の脱毛剂。

(3) B系中の成分と該ポリマーとが酸・塩基反応をし、固化被膜を形成する特許請求の範囲第(1) 項記載の脱毛剤。

#### 3. 発明の詳細な説明

### (産業上の利用分野)

本発明は人体面の体毛を痛みを伴うことなく美 麗に除毛することができる脱毛剤に関するもので ある.

### (従来の技術)

従来、脱毛剤としてはワックスの態機のものと 脱毛薬物含有クリーム態機のものが実用化されて いる。脱毛クリームにおいてはクリームを脱毛郎 位に堕布後、所定時間放置し、その後拭き取るこ とによって脱毛を行っている。

しかし、このような方法においては、脱毛剤を 塗布後、拭き取る際に、薬剤による体毛の分解に より不快臭が発生したり、強く接ることによって 皮膚刺激が起生したりするという問題がある。

また、ワックスを用いる場合は物理的脱毛であ り、滋痛を伴うという問題がある。

### (発明が解決しようとする問題点)

従って、本発明は後処理の煩雑さ、不快臭の発生、激痛などを伴わずに脱毛処理を可能にする脱毛剤を提供するものである。

## (問題点を解決するための手段)

本発明は、ポリマー溶解物またはポリマー形成性化合物溶解物よりなる系 (A系) ならびに該ポ

リマーまたはポリマー形成性化合物と反応して 離可能な固化被膜を生じる成分を含有する系 (B 系)の二成分系よりなり、A系およびB系の少な くとも一方の系に脱毛薬物を含有させてなる脱毛 剤に関する。

本発明にて使用されるA系は、少なくともポリマーまたはポリマー形成性化合物 (以下、これらを総称して単に高分子性化合物ともいう) およびこれを溶解しうる溶媒よりなるものである。

ポリマーとは、それ自体でポリマーを形成している化合物であり、またポリマー形成性化合物とは、後配B系中の成分と反応してポリマーを形成してる化合物であり、通常は単層体である。

高分子性化合物としては、固化被膜形成能を有し、 本発明の目的を連成しうるものであれば特に限定 されるものではない。高分子性化合物の具体例と しては、たとえばポリアクリル酸およびその塩、 ポリアクリルアミド、セルロースエステル類、ア ルギン酸およびその塩等の金属塩と架橋を形成す る高分子性化合物、酸性高分子性化合物 (ポリア

高分子性化合物のA系中への添加量は、被膜を 形成せしめた限に、脱毛部分の皮膚から容易に倒 離しうる強度が得られるに十分量配合される。そ の量は、選ばれた高分子性化合物によって適宜増 減されるが、通常1~70重量%、好ましくは2 ~50重量%である。

脱毛薬物は、通常A系に配合される。脱毛薬物としては、特に制限はなく、従来既知のものを用いればよい。具体的にはチオグリコール酸およびその塩、硫酸ストロンチウム、硫化ナトリウム、硫化バリウム、硫化カルシウム等が挙げられ、これらのうち一種または複数の混合物としてもよい。脱毛薬物はA系中には1~15重量%、好ましくは3~12重量%程度配合される。

A系中には他に香料、体毛膠洞促進剤などを所 望により添加しうる。

B系は上記A系中の高分子性化合物と反応して 固化被膜を生ぜしめる成分よりなるものであり、 かかる性質を有するものであれば特に制限されない。かかる成分としては、たとえば当該高分子性 クリル酸およびその塩、アルギン酸およびその塩等)、塩基性高分子性化合物(ポリアクリルアミド、ポリビニルビロリドン等)の酸・塩基反応によって固化被膜化する酸・塩基反応によって固化被膜化する高分子性化合物、イソシアネート基、エポキシ基などの活性基を有する高分子性化合物等が例示される。

これら高分子性化合物は水溶性、非水溶性のい ずれでもよい。

また、これら高分子性化合物は単一または複数 の混合物としてもよい。

非水溶性高分子性化合物を溶解しうる溶媒は、 皮膚に対して刺激の少ないものが望ましく、エチ ルアルコール、プロピルアルコール、ベンジルア ルコールなどのアルコール類、これらの混合物、 これらと水との混合物(例、水ーエチルアルコー ルなど)が挙げられる。水溶性高分子性化合物は、 勿論水、水性溶媒に溶解して用いられる。

A系は好ましくは溶液状であるが、ゾル状、ベースト状であってもよい。

化合物を架橋する金属塩(態様①)、当該高分子性化合物と酸・塩基反応を生起する化合物(腹様②)、活性基を有する高分子性化合物と反応性の化合物(腹様③)などが好ましいものとして挙げられる。

脱毛薬物はB系中に配合させてもよく、その際 の配合量はA系におけると同程度でよい。

態様のは高分子性化合物とB系中の金属塩とによって架橋物を形成させて固化被膜とし、剔離容易な状態にして脱毛することを特徴とするものである。

腹機①においては、A系は、少なくとも金属架 機されうる高分子性化合物および溶媒からなる。 これに対してB系は、高分子性化合物と反応して 架橋を形成する金属塩よりなる。

当該高分子性化合物は、ポリアクリル酸および その塩、ポリアクリルアミド、ポリビニルピロリ ドン、カルボキシメチルセルロース、メチルセル ロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキ シブロビルセルロース、アルギン酸およびその塩

C.

等の金属塩架橋可能な化合物である。

これに対するB系は、A系中の高分子性化合物と架橋を生起しうる金属塩からなる。金属塩としては、カルシウム塩、アルミニウム塩、亜鉛等の金属塩およびその酸化物等が好ましく、具体的には塩化カルシウムなどが挙げられる。金属塩は高分子性化合物と反応して架橋を形成し、被膜としうる量であればよい。高分子性化合物の量によるが、B系中1~2-0重量%、好ましくは2~10重量%程度添加される。

脱毛薬物として、金属塩類、特にチオグリコール酸の上記塩類を使用する場合には、金属塩架橋 の反応剤としても兼ねることができる。

艦機のは高分子性化合物と酸・塩基反応により、 固化被膜を生ぜしめ、銅雕容易な状態にすること を整徴とするものである。

本腹様においては、A系は、少なくとも酸・塩 基反応により容易に被膜を形成しうる高分子性化 合物および溶媒からなる。これに対してB系は、 高分子化合物と反応しうる酸または塩基成分から

性化合物を使用すればB系では酸性高分子性化合物または多官能性酸性化合物が使用される。酸性および塩基性高分子性化合物としては、A系におけると同様のものが例示される。また、多官能性化合物としては、マレイン酸、フマル酸、などの酸性化合物またはエチレンジアミン、テトラエチレンベンタミン、などの塩基性化合物が例示される。

これらの酸・塩基反応の配合量は、A系中の高分子性化合物と反応して被膜を形成しうる量であればよく、高分子性化合物の量により適宜増減されるが、B系に対して1~50重量%、好ましくは2~30重量%である。

態機③としては、活性基を有する高分子性化合物と反応性を有する化合物とを反応させて固化被腰を形成せしめることを特徴とするものである。

A系は少なくとも活性基を有する高分子性化合物および溶媒からなる。これに対してB系は該高分子性化合物と反応する成分よりなる。

なる.

高分子性化合物としては、酸性高分子性化合物 または塩蒸性高分子性化合物が使用される。酸性 高分子性化合物としてはカルボン酸基を有するポ リアクリル酸、アルギン酸、およびそれらの塩類 が挙げられる。塩蒸性高分子性化合物としてはポ リアクリルアミド、ポリビニルピロリドン、など が挙げられる。

これらは単一又は複数の混合物としてもよい。 高分子性化合物の添加量は、被膜を形成せしめた 際に脱毛部分の皮膚から容易に剝離しうる強度が 得られるように配合されるのが望ましい。また、 選ばれた高分子性化合物によって適宜増減されう るが、連常1~70重量%、好ましくは2~50 電量%である。

高分子性化合物と反応しうる酸または塩基成分は、上記高分子性化合物と相補的であり、A系において酸性の高分子性化合物を使用すればB系では塩基性高分子性化合物または多官能性塩基性化合物が使用され、逆にA系において塩基性高分子

高分子性化合物はイソシアネート基、エポキシ基等の官能基を有する化合物で、たとえば、テトラメチレンイソシアナート、ヘキサメチレンイソシアナート、ドリイソシアナート、ビスフェノールAなどが例示される。

これに対してB系は高分子性化合物中の前記官 能基と反応しうる成分よりなるものであり、当該 成分としては、ヘキサメチレングリコール、ブチ レングリコール等のイソシアナート基と反応性の 化合物、エピクロロヒドリン等のエポキシ基と反 応性の化合物などが例示される。B系中の成分は 高分子性化合物と反応して被膜を形成しうる量で あればよい。

なお、B系が溶媒のみの液状である場合には、 使用に際して便宜的でない。従って、本発明においては当該溶媒合有のシート状に成形したものと することが好ましい。かかるシート状成形物とし ては、不機布、紙、発泡シートなどの多孔性シー ト状物に含浸等の処理を施したゾル状シート状物 などが例示される。

### 特開昭61-282311(4)

本発明の脱毛剤は、まずA系を脱毛局所に塗布 した後、B系を配設することによって使用に供される。

かくして、A系中の高分子性化合物はB系中の 成分と反応し、固化被膜が形成される。しかして、 体毛は被膜中にトラップされた状態となり、被膜 を銅雕することによって、脱毛薬物によって毛根 部分が弱められた体毛は美麗に除毛される。

(作用・効果)

本発明の脱毛剤は、高分子性化合物溶解物が反応によって容易に被膜を形成するとともに、ここに配合されている脱毛薬物によって毛が少なくとも飲化されている。従って、ワックスによる物理的脱毛と異なり、体毛を飲弱化できるため、脱毛時の激痛を回避できる。また、体毛を被膜内にトラップした状態にし、被膜を剝離するのでクリーム剤に見られるような不快臭の発生、後処理の問題は解消される。

### (実施例)

以下に実施例にて、本発明をさらに詳しく説明

ポリアクリル酸ナトリウム 20% チオグリコール酸ナトリウム 7% 水 73% ・B系 ポリアクリルアミド 20% 水 80%

B系をシート状に流延する。A系を脱毛部位に 塗布後、上記きシート状のB系を重ね合わせた。 10分後、固化被膜が形成されており、倒離した。 剝離した部分はきれいに除毛されていた。

特許出願人 日東電気工業株式会社 代 理 人 弁理士 高 島 一

する。文中、%とあるのは重量%を意味する。 実施例 1

A系およびB系は次の成分からなる。

· A 系

ポリアクリル酸ナトリウム 20% チオグリコール酸ナトリウム 7% 水 73%

• в ж

塩化カルシウム 6 % ポリビニルアルコール 2 0 % 水 7 4 %

B系はシート状にしたものを作成した。均質な高分子溶液を脱毛部位に堕布し、この上に上記のシート状のB系を重ね合わせた。10分後、固化被膜が形成され、脱毛薬物の作用によって毛根部分が弱められた体毛と共に剔離された。脱毛部分には残留物もなかった。

#### 実施例 2

A系およびB系の成分は次の通りである。

· A 系